(9) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-140781

f) Int. Cl.<sup>3</sup>G 09 F 9/30

識別記号

庁内整理番号 6615-5C 7348-2H **43公開 昭和58年(1983)8月20日** 

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

## **9**画像表示装置

G 02 F

②特 願 昭57-22744

②出 願 昭57(1982)2月17日

1/133

饱発 明 者 松井誠

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

所内

⑩発 明 者 大和田淳一

日立市久慈町4026番地株式会社

日立製作所日立研究所内

⑩発 明 者 白木靖寛

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑫発 明 者 丸山瑛一

国分寺市東恋ケ窪 1 丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

#### 明 紐 書

発明の名称 画像表示装置

#### 特許請求の範囲

- 1. 透光性絶縁基板上に配列された画像袋示部と 政透光性絶縁基板上に形成された半導体層に形成されたトランジスタ部とを少なくとも有する 画像表示装置において、少なくとも餃トランジ スタ部の配線部は前記透光性絶縁基板上に形成 された半導体層上に延在して成ることを特徴と する画像袋示装置。
- 2 特許請求の範囲第1項記載の画像表示装置に おいて、前配半導体層が複数個の開孔部を有し、 該半導体層に前配トランジスタ部および該層上 に該トランジスタ部の配線部が延在し、前配開 口部が画像表示部を構成して成ることを特徴と する画像表示装置。
- 3. 特許請求の範囲第1項又は第2項記載の画像 表示装量において前記半導体層が節状に形成されて成るととを特徴とする画像表示装置。

発明の詳細な説明

本発明は、薄膜トランジスタ駆動の画像表示装置に関するものである。例えば、アクテイブ・マトリックス駆動方式の液晶要示装置やエレクトロルミネンセンス表示装置等に応用できる。

近年、画像表示英量の薄型化。軽量化を目的として、薄膜トランジスタのスイッチ・マトリックスによつて走査する方式の液晶もしくはエレクトロルミネッセンス等の画像表示装置の開発が進められている。

画像表示装置としては、画象部分の基板が透光性であるととが望ましい。その理由は、光を表示方式選択の編が広がり、その結果、例えば、ツッドオマチック液晶に二枚の偏光板を用明するステッドオマチック液晶をでするの良い画像を得ることが可能となり、あるいは、また、三色のガインタを透過するだいよう。存取してある。存取してある。なのスイッチ・マトリックスを画像表示装置によっていまり、カールのストリックスを画像表示装置によっていまり、カールのスイッチ・マトリックスを画像表示装置によっては、画像表示装置によっては、画像表示装置によっては、画像表示装置によっては、画像表示装置によっては、画像表示装置という。

用する場合には、位づて、画素部分を透光性にするために、ガラスヤ石英等の透光性基板を用いるとともに、薄膜トランジスタを構成する半導体薄膜は画素以外の部分に選択的に形成されているととが望ましい。

ような段差を有する膜11の上に電極配線12を 行なうと、電極配線に13のような断線が生じや すいという欠点があつた。従つて、写真会刻法に よつて島状に選択エッチした半導体薄膜上に形成 した薄膜トランジスタのスイッチ・マトリックス は、配線の断線による欠陥が生じやすいという欠 点を有していた。

機膜5の上に形成されたゲート電信6は、走査電信を兼ねている。8は電信も、半導体材料もない部分を示している。

ととろで、最近では、例えば、多結晶シリコン 膜等を用いて、単齢晶シリコン・デバイスと同様 な製作工程により、薄膜トランジスタを形成する ととが試みられている。との場合には、写真食刻 法を用いてパターン形成を行たりが、とのととは、 **薄膜トランジスチの特性向上や配額パターンの高** 精度化の見地からは望ましいことである。また、 画像表示装置としては、画彙部分の基板が透光性 であることが望ましいことは既に述べたとおりで ある。従つて、薄膜トランジスタを構成する半導 体薄膜を写真会刻法により選択的にエッチングし て、画素部分の半導体薄膜を除去するととが望ま しい。との場合、島状に半導体薄膜を残すと以下 のような問題が生する。すなわち、写真食刻法に よつて形成したパターンの断面は、例えば、第3 ・図に示すように、急激に膜厚しから膜厚しへと変 化する。したがつて、第4図に示すよりに、との

ては、全体として見た時の表示のコントラストが 悪いという欠点があつた。勿論、この欠点は、喪 示に関係のない部分の透過光を連載するようなマ スクを外部に設けることによつて除去できるが、 この場合、マスクを設けることによる工程の増加 および生策コストの増大という欠点が生する。

本発明の第1目的は、写真食知法を用いて薄膜トランジスタのアクテイブ・マトリックスを形成する場合においても、電極配線に断線の生じにくい構造のアクテイブ・マトリックスを提供しようとするものであり、欠陥の少ない良好な画像を表示する画像表示装置を提供しようとするものである。

本発明の第2の目的は、簡便に作成可能であつてかつ表示のコントラスト比が良好な、画像表示 装置用薄膜トランジスタ・マトリックスの構造を 提供しようとするものである。

上記第1の目的を達成するために、本発明においてはたとえば朝状もしくは目あき状に半導体薄膜を選択エッチし、半導体薄膜の存在する部分の

特開昭58-140781 (3)

上に透明電極以外の電極を配線する構造を採る。 その結果、透明電極以外の配線が、半導体構態に よる段差部分を横切ることがなくなり、従つて、 段差部分において、断線の生じる恐れがなくなる。 上記第2の目的を達成するために、第6図に示す よりに解状に形成した半導体構態21の存しない 部分22を覆りよりに透明電極27が設けられた 構造を採る。

以下、本発明を実施例を参照して詳細に説明する。

### 夹施例 1

石英基板上に形成した多結晶シリコン膜を用いて、5条子×5条子の多結晶シリコン薄膜トランジスタのスイッチ・マトリックスを形成し、このスイッチ・マトリックスと液晶表示案子とを組み合わせて形成した、5 画条×5 画案の画像表示装置についての実施例を説明する。

石英基板上に多結晶シリコン膜を1 A mの厚さ に形成し、第 5 図に示すように多結晶シリコン膜 ・ 限は例もかっている子供で表すとなっ。 を能状に選択的にエッチングする。第 5 図は画像

インジウム錫等の共通透明電優32を設け、両者の間に例えば、PCH系被品、ピフェニール系被品等の被品33を對入することによつて、5画素×5画素の抵過型の液晶表示装置を形成した。透明面低27と共通透明電低32との間隔、すなわち被品の厚さは10μmである。被品表示接近そのものの構成の中り方は従来のものと同様である。一方の面板上の構成が異なるだけである。共通透明電低32はガラス基板34によつて支持されている。なか、20はスイッチ・マトリックスを形成した石英基板である。

第6図、第7図より明らかなように、本発明に よれば、ソース電極24。ドレイン電極兼信号電 値25。ゲート電極兼走査電極26は、いずれも、 多結晶シリコン膜の段差を横切ることはない。従 つて、多結晶シリコン膜の段差による前記三電極 の断線の可能性はなくなり、本実施例によれば、 欠陥の少ない良好な画像を表示するととができた。

たか、透明函素電信27は、第6図。第7図か ら明らかなように、必然的に多結晶シリコン膜の

平面図でもつて、斜線部21の多 表示装置全体 結晶シリコン膜を設すよりに選択的にエッチング する。多結晶シリコン膜を除去した部分22が函 柔部分となる。そして、との部分は透光性絶縁基 板が舞出している。第6図は一画素分を拡大した スイッチ・マトリックスの平面図であり、年7図 は、第6図BB′の断面図である。両図面で同一 番号は同一部位を示している。選択エッチによつ て残された多齢品シリコン膜21のうちの23の 部分に、MOS型電界効果トランジスタを形成し、 ソース電框24。ドレイン電框兼信号電極25。 ゲート電極兼走査電極26を設ける。信号電極 2.5と走査電框2.6との交点は、絶縁体で絶縁さ れた二唐配譲となつている。その後、檄化インジ ウム錫等の透明画素電価27を形成するが、この 透明画素電信は、ソース電信24と電気的に接続 し得るよう、かつ、多粧品8l腹を除去した画祭 部分22を覆りよりな構造とする。以上のように して形成した薄膜トランジスタのスイッチ・マト リックス31に対向して、第8図のように、酸化

段差部分をまたぐ構造となる。しかし、透明画素 電低 2 7 は、長い段差部分の一部分でもつながつ ていればよいことから、この段差が原因で透明画 素電振に断線が生じることはなかつた。

簡状に形成した多結品SI膜は、各面素に印加される電圧に依らず光の透過率が小さいので、表示に関係のない部分の透過光を遮蔽する。したがって、本実施例によれば、全体として見た時の表示のコントラスト比が向上した。

本実施例においては、全体として見た時の表示 のコントラスト比を向上させるために、表示に関 係のない部分の透過光を遮蔽するようなマスクを 特別に設けるととはせず、薄膜トランジスタの素 材である半導体薄膜に上述のマスクの機能を持た せている。従つて、余分のマスクを設置する必要 がたいので、生産工程が簡単になり、生産原価を 低減するととができるので、本発明は工業的価値 が高い。

突施例 2

エレクトロ・ルーネッセンス(EL)表示袋置 に本発明を用いた場合の実施例を以下に説明する。 第9図は、EL表示袋費用の薄膜トランジスタ・ スイッチ・マトリックスの実施例の一画業分を示 す平面図である。 朝秋に形成した半導体薄膜 4.1 上に2個の薄膜トランジスタ42。43。並びに 電原電極44。走査電極45,信号電極46。の 3 つの電極配線を形成し、 B L 衆子の画素電板 47および容量48と結合している。斜線を施し た領域以外に半導体薄膜が設けられている。この 等価回路は第10図に示した通りであり、この回 路はEL案子の駆動用トランジスタ・マトリック スとしては、一般的である。との薄膜トランジス タ・マトリックス上にEL素子48を形成し、更 にその上に共通対向電極49を形成した。EL素 子は、例えば、庚厚5000人の2m8:Mnの活 性層の両側を膜厚2000人の絶縁層、例えば Sm<sub>2</sub>O。 膜ではさんだものである。画衆電低47 もしくは、共通対向電征48のうちいずれかは透 明電幅で形成し、ととから発光した光を取り出す。

・スイッチ・マトリックスの一画素分を示す平面 図および断面図、第3図は写真食刻法により選択 的に形成した薄膜パターンの断面の形状を示す図、 第る図は段差による断線の断面を示す図、第5図 は本発明の実施例の簡状に形成した半導体薄膜の 形状を示す平面図、第6図および第7図は本発明 の実施例の薄膜トランジスタ・スイッチ・マトリ ックスの一画衆分を示す平面図および断面図、第 8 図は本発明の実施例の液晶表示素子の断面図で ある。第9図はEL表示装置の部分平面図、第 10図はEL表示装置の等価回路図である。 1…透光性絶縁基板、2…半導体薄膜、3…ソー ス電極、4…ドレイン電極、5…ゲート絶級膜、 6 …ゲート電極、7 …透明電極、8 … 気極でもな く半導体薄膜でもない部分、11… 段差、12… 或便配额、13…断额、20…石英基板、21… 節状に選択的に形成された多結晶シリコン膜、 22…多結晶シリコン膜を除去した部分、23… MOSFET を形成した部分、24…ソース電框、 25…ドレイン電極兼信号電極、26…ゲート電

との場合、発光素子なので、表示に関係のない部分が、表示のコントラストを低下させるというととはないので、本実施例にかいては本発明の第2の効果、すなわち表示品質を高めるという効果はない。しかし、本実施例にかいては、本発明によって電極配線に断線が超とりにくくなり、したがつて欠陥の少ない良好な画像を表示するEL表示装置が得られた。

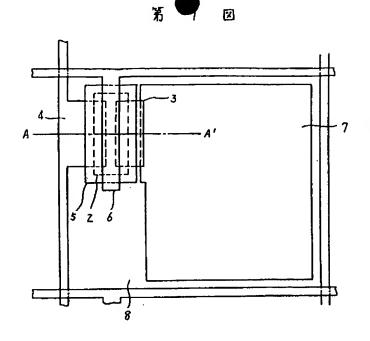
との様に本発明は種々の表示装置に適用すると とができる。

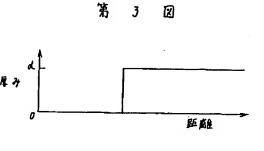
以上詳述したどとく、本発明によれば、電極配線の断線を低減することができ、また、特別のマスクを用いることなく、表示に関係のない部分の透過光を遮蔽することができる。従つて、本発明によれば、欠陥が少なくて、コントラスト比の良好な、良質の画像の表示装置を、関便に、低原価で作製することができ、工業的効果大なるものがある。

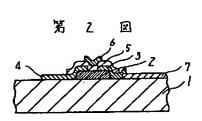
図面の簡単な説明

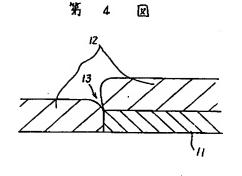
第1図および第2図は従来の薄膜トランジスタ

極兼走査電極、27…透明画業電極、31…薄膜 トランジスタ・スインチ・マトリンクス、32… 共通透明電極、33…液晶、34…ガラス基板。 代理人 弁理士 薄田利幸

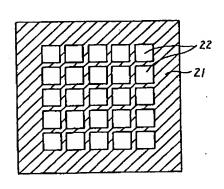


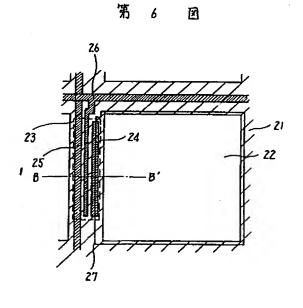


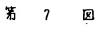


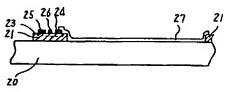




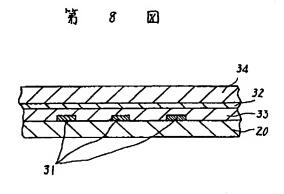


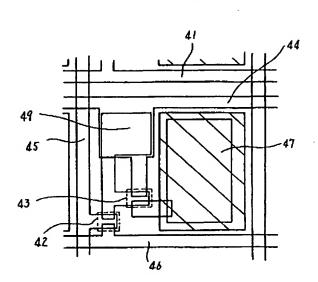






# 第 9 図





## 第 10 図

